

ABSTRACT

A method for manufacturing plasma display panels (PDP) is disclosed. The method appropriately controls conditions in an evaporating room during the process of forming film on a substrate of the PDP, thereby obtaining quality
5 film. The method includes a deposition step where film is formed on front substrate (3) held by substrate holder (30), which is repeatedly used in the deposition step. Substrate holder (30) attached with the film due to repeated use co-exist in evaporating room (21) with another substrate holder (30), from which the film attached is removed, so that the conditions such as a degree of
10 vacuum changes only a little.

Rec'd PCT/PTO 29 NOV 2004

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)

PCT

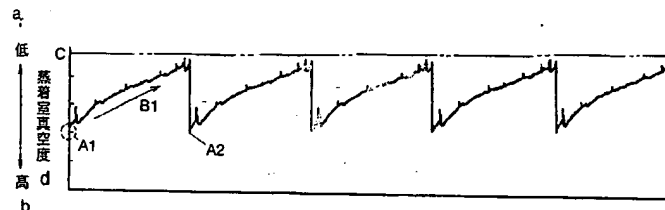
(10) 国際公開番号
WO 2004/090927 A1

- (51) 国際特許分類: H01J 9/46, 9/20, 11/02, H01L 21/68, C23C 14/50
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004900
- (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 5 日 (05.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2003-101264 2003 年 4 月 4 日 (04.04.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 篠崎 淳 (SHINOZAKI, Atsushi), 高瀬 道彦 (TAKASE, Michihiko), 古川 弘之 (FURUKAWA, Hiroyuki).
- (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続葉有/

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING PLASMA DISPLAY PANEL

(54) 発明の名称: プラズマディスプレイパネルの製造方法



a...LOW
b...HIGH
c... VACUUM DEGREE IN DEPOSITION CHAMBER

(57) Abstract: A method for manufacturing a plasma display panel is disclosed which enables to form a good film on a substrate of the plasma display panel by controlling the condition in a film-forming chamber properly. The method for manufacturing a plasma display panel comprises a film-forming step wherein a film is formed while a front substrate (3) is held by a substrate holder (30). The substrate holder (30) is repeatedly used for film formation. In the film-forming step, a substrate holder (30) which is repeatedly used and covered with films and another substrate holder (30) from which such adhering films are removed are used together in a deposition chamber (21) as the film-forming chamber, thereby suppressing changes in the vacuum degree or the like in the deposition chamber (21).

(57) 要約: プラズマディスプレイパネルの基板への成膜において、成膜室の状態を適正に制御することで、良好な膜を形成することができるプラズマディスプレイパネルの製造方法である。前面基板(3)を基板保持具(30)に保持させて成膜を行う成膜工程を有するディスプレイパネルの製造方法であり、成膜に際し、基板保持具(30)は繰り返し使用し、成膜工程は、繰り返し使用することにより膜が付着した状態となっている基板保持具(30)と、付着した膜を除去した状態とした基板保持具(30)とを、成膜室である蒸着室(21)内に混在させて行い、蒸着室(21)内の、真空度などの状態の変化を小さくする。